Japan Patent Office (JP)

Public Report of Opening of the Patent

Opening No. of patent: No. H 1-301880

Date of Opening: Dec. 6, 1989

Int.Cl.

Distinguishing mark Adjustment No. in office

C 25 D 1/00

321

7730-4K

Request of judgment: pending Number of items requested: 3

Name of invention: manufacturing method for a stamper for optical disk substrate

Application of the patent: S 63-132009 Date of application: May 30, 1988

Inventor: Yasuto Nose

Seiko Epson Corp., 3-5 3-chome Yamato Suwa-shi, Nagano

Applicant: Seiko Epson Corp.

4-1 2-chome Nishi-Shinjuku Shinjuku-ku, Tokyo

Assigned Representative: Kisaburo Suzuki, Patent Attorney, and 1 another

Detailed report

1. Name of the invention

manufacturing method for a stamper for optical disk substrate

2. Sphere of patent request

(requested clause 1)

This invention is regarding a manufacturing method for a stamper for optical disk substrates which has the following characteristics: A release layer such as CrO₂, TiN is applied to the surface of a father stamper completed by a laser cutting mastering process. Next, a replica is produced by a 2P (photo polymer) mold. Using this replica as a master, the surface is made electrically conductive by applying a nickel layer by sputtering and a nickel electroplating process is done. Back side grinding and inner and outer diameter sizing are done, and a child stamper is made.

(requested clause 2)

This invention is regarding the manufacturing method for a stamper for the optical disk substrate in requested clause 1 where the base of the 2P replica mold is a glass or plastic substrate at least 2 mm thick.

(requested clause 2)

This invention is regarding the manufacturing method for a stamper for the optical disk substrate in requested clause 1 where a metal, glass, or ceramic plate is attached to the back side of the molded 2P replica.

3. Detailed explanation of invention (field of industrial use)

This invention is regarding a manufacturing method for a stamper for substrates for optical memory such as compact disks, optical magnetic disks, etc.

(prior art)

In the former manufacturing process for a stamper for optical memory substrates, a photo resist is first applied uniformly on a ground glass substrate by a spin coater to form a layer with the necessary thickness. After pre-baking, it is exposed by a laser cutting machine. It is then developed, and the desired pits or grooves are formed.

Next, silver or nickel is sputtered on this original glass disk. After its surface is made conductive, nickel electroplating is done. Next, it is finished to a uniform thickness and surface roughness by back side grinding.

This electroplated nickel layer is peeled off from the glass substrate. After the inner and outer diameter are sized, resist is removed by solvent washing, and the stamper is complete.

When a child stamper is produced using this stamper as the father, the father stamper is immersed in a bichromic acid solution in a mold-release process. Next, after the surface is made conductive by nickel sputtering, nickel electroplating are done, and it is released from the father stamper. A mother stamper which is the master for the child stamper is made.

By performing the same process using this mother stamper, a child stamper is copied from the father.

(problems that this invention tries to solve)

In the prior art, when the father is used as a stamper to form the substrate directly, all processes starting from polishing the glass have to be done for each stamper, so the numbers of process steps is high, and so is the cost.

Since process conditions change for each stamper, quality is not stable. The lead pitch of an optical magnetic memory substrate is very critical. Making stamper fit this standard has had many problems.

In producing a child stamper from the father, the number of processes is too high because of repeated nickel electroplating and back-side grinding. It has had many other problems such as generation of strain (warping) due to stresses form nickel electroplating. The process in this invention is much better since the back-side grinding of the final child stamper is the only grinding process required.

Therefore, in order to solve these problems with the former method, the object of this invention is to reduce the number of process steps a great deal and to improve and stabilize the quality of the child stamper by simplifying the process.

(steps for solution)

In order to solve the above problems, the manufacturing method for a stamper for optical disk substrates of this invention has the following characteristics: The surface of a father stamper completed by a laser cutting mastering process is coated with a release film such as CrO_2 or TiN. Next, a replica is made in a 2P (photo polymer) mold. Using this replica as a master, the surface is made conductive by nickel sputtering, and a nickel electroplating process is done. Back side grinding is done and the inner and outer diameters are sized, and the child stamper is complete.

The base of the replica in the 2P molding process is a glass or plastic substrate at least 2 mm thick. A metal or ceramic plate is attached to the back side of this replica.

(function)

According to this invention, it is possible to manufacture many child stampers from one father stamper with good quality by using replicas made by 2P molding as masters having equal quality to that of the father.

By using a mold-release process on the surface of the father stamper, it is possible to release the 2P mold replica easily from the stamper surface. Contamination of the father stamper surface is minimum, and 2P molding can be done continuously.

Since it is possible postpone rear-side grinding of this replica until after the conductive process and electroplating, there is no damage to the surface of the stamper, unlike the former process which had several grinding steps.

The reason that a thick glass or plastic substrate is used as a base for the replica or why a metal or ceramic plate, etc., is attached to the back side of the replica is to improve strength of the replica which has been molded by the 2P process. By doing so, deformation of the replica due to stress in the electroplating process or back side grinding is prevented.

(example of practice)

In the following, one example of practice of this invention is going to be explained based on figures.

First, a father stamper was evaluated by a stamper inspection device, and defects and lead characteristics were measured. A good product stamper 1 which was qualified to a predetermined spec was selected.

On the surface of this stamper, a mold release layer of TiN film 2 was formed with a thickness of approximately 500 A by sputtering.

On the treated surface of this stamper, 2P resin 3 was applied. After defoaming, a clear plastic substrate 4 was applied, and it was cured by UV irradiation 5.

After curing, the replica plate (4, 5) was peeled off from the stamper 1. Next, a 4 mm thick glass plate 6 was attached to the back side of this replica using epoxy adhesive.

After a nickel sputtering process (7) was done to this replica (4, 5, 6) to make its surface conductive, nickel electroplating was done, and its thickness was approximately 300 µ. (8)

Next, this electroplated surface was ground directly, and it was finished to a predetermined thickness and surface roughness. Finally, the nickel electroplated layers (7, 8) were stripped from the replica plate. After the inner and outer diameters were sized,

washing was, and a child stamper used for molding substrates for optical memory was manufactured.

(effects of this invention)

As stated above, in this invention a stamper for optical disk substrates is manufactured by first applying a release film such as CrO_2 or TiN to the surface of a father stamper. Next, a replica is made by 2P (photo polymer) molding. Using this replica as a master, the surface is made conductive and nickel electroplating is done. This is the manufacturing process for a stamper for optical substrates. By performing it repeatedly using the same father stamper, it is possible to manufacture many child stampers from one good father stamper easily.

The reason that a thick glass or plastic substrate is used as a base for the replica or why a metal or ceramic plate, etc., is attached to the back side of the replica is to improve strength of the replica which has been molded by the 2P process. By doing so, deformation of the replica due to stress in the electroplating process or back side grinding is prevented.

4. Simple explanation of figures

Figure 1 (a) to (e) show the manufacturing method for a stamper for optical disk substrates according to this invention.

- 1: father stamper
- 2: TiN film
- 3: 2P resin
- 4: plastic substrate
- 5: UV irradiation
- 6: glass plate
- 7: nickel sputtering
- 8: nickel electroplating

Applicant: Seiko Epson Corp.

Assigned Representative: Kisaburo Suzuki, Patent Attorney, and 1 other

19 日本国特許庁(JP)

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 平1-301880

@Int. Cl. 4

識別記号

广内整理番号

码公開 平成1年(1989)12月6日

C 25 D 1/00

321

7730-4K

審査請求 未請求 請求項の数 3 (全3頁)

の発明の名称

光ディスク基板用スタンパーの製造方法

②特 顯 昭63-132009

②出 頭 昭63(1988)5月30日

@発明者 野瀬

保 人

長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコーエプソン株式

会社内

勿出 顕 人 セイコーエプソン株式

東京都新宿区西新宿2丁目4番1号

会社

砂代 理 人 弁理士 鈴木 喜三郎 外1名

明 概 書

1. 発明の名称

光ディスク基板用スタンパーの製造方法

2.特許請求の範囲

- (2) 2 P 成形でのレブリカのペースが厚さ 2 mm 以上のガラスもしくはブラスチック基板である事 を特徴とする第 1 項に記載の光ディスク基板用ス メンバーの製造方法。
 - (3) 2P成形により製作されたレブリカ裏面に

金属、ガラス、セラミック板等を貼合せた事を符 後とする第1項に配数の光ディスク基板用スタン パーの製造方法。

5.発明の幹細な説明

[産業上の利用分野]

本発明は、コンパクトディスク, 光磁気ディスク等の光メモリー用基板を複製するためのスタンパーの製造方法に関するものである。

[従来の技術]

従来の光メモリー基板複製用スタンパーの製造方法は、表面研摩したガラス基板に、フォトレジストをスピンコーターで必要な厚さに均一に強布し、アレベーク後レーザーカッティングマシーンで露光さらに現像して、任意のピットあるいはグループを形成する。

このガラス原盤に、銀あるいはニッケルをスペックして導電化後ニッケル電網を行ない、次に裏面研磨により均一な厚ミ,面租度に仕上げる。

このニッケル電鍋層をガラス基板より剝がし、 内外径加工後、溶剤によるレジスト除去洗浄を行 なってスタンパーとして完成させる。

さらに、このスタンパーをファーザーとして、 チャイルドスタンパーを複製する場合は、ファー ザースタンパーを重クロム酸液に浸漉して、耀型 処理を行ない、次にニッケルスパッタによる導電 化・ニッケル電鈎を行なった後ファーザースタン パーより剝騰して、チャイルドスタンパーのマス ターになるマザースタンパーとする。

このマザースタンパーを用いて同様のアロセス を行なう事によってファーザーより複製されたチャイルドスタンパーとする事ができる。

[発明が解決しようとする舞躍]

前述の従来技術では、ファーザーを直接基板成形用のスタンパーとして使用する場合、ガラス研磨からのすべての工程を、各々のスタンパーについて行なうために工数がかかりコスト高であった

[課題を解決するための手段]

また、2P成形時のレブリカのペースが厚さ2 ms以上のブラスチックもしくは、ガラス落板であること、あるいは、このレブリカの裏面に金属, セラミック等のフラン板を貼合せた事を特徴とする。 また工程の条件が、それぞれのスタンパーによ うて変動するため、品質にパラツキが生じ、 特に 光磁気メモリー基板のリードキャラクタリスティ ックの規格は非常にクリティカルであり、 スタン パーをこの規格に適合する様につくり込むために は、多くの問題があり歩留りも低いものであった

またファーザーよりのチャイルドスタンパーの 複製においても、ニッケル電鋼,裏面研磨を とり 返し行なう事によって工数がかかっていた。 さら にニッケル電鍋時の応力によるひずみの発生、 また最終チャイルドスタンパー上りでの裏面研磨が 、単品研磨となるためのヘンドリングのむずかし さ等、多くの問題を有していた。

そこで、本発明は従来のこの様な問題点を解決 するため、スタンパーの複製方法を簡便にする事 により、大巾な工数低減と、複製されたチャイル ドスタンパーの品質向上、安定化する事を目的と する。

[作用]

本発明により、品質の良いファーザースタンパーが 1 枚あれば、 2 P 成形をくり返し行なってつくられたレブリカをマスターとして使う事により、ファーザーと同等の品質をもつチャイルドスタンパーを容易に数多く作成する事が出来る。

ファーザースタンパー袋面に種型処理を施す事により、2 P 成形レブリカを簡単にスタンパー面から斜端する事が出来、ファーザースタンパー面のコンタミも少なく、連続して2 P 成形が出来る

さらに、このレブリカに導電化処理・電鋼後・ そのまま裏面研摩が出来るので、単品研摩の様な スタンパー表面のダメージがまったくない。

レブリカのペースとしてのガラスまたはブラスチック基板にある程度の厚さをもたせる、あるいは、レブリカの裏面に、金属、セラミック板等をはりつけるのは、2P成形されたレブリカの別性を上げるためで、これにより電鏡、裏面研摩時の応力によりスタンパーが変形するのを訪いでいる。

[实施例]

以下に、本発明の実施例を図面に基づいて説明する。

まず、製作されたメモリー用ファーザースタンパーをスタンパー検査装置により評価し、欠陥・リードキャラクタリスティック等を測定し、所定のスペックに合致する良品スタンパー1を選定する。

このスタンパー表面に、種型用として、 T i B 皮膜 2 をスパッタ処理により 5 0 0 Å 程度形成する。

この難型皮膜を適したスタンパー袋面に、2 P レジン 5 を塗布し、脱泡袋透明 アラスチック基板 4 を貼合せ、 U V 照射 5 により 硬化させる。

硬化後、スタンパー1よりレブリカ板(4,5)を剝離し、さらに、このレブリカ板の裏面に、エポキシ接着刷等を用いて厚サ4mのガラス板 6を貼合せる。

このレブリカ(4,5 , 6)にニッケルスパッタ導電化処理(7)した後、ニッケル電鋼を行な

る、あるいは、基板製面に、金属。ガラス板等を 貼合せるのは、レブリカ板の創性を上げ、電路も しくは裏面研選時の応力によるスタンパーの変形 を防ぐためである。

4.図面の通単な説明

第1回(4)~(4)は、本発明による光ディスク基板用スタンパーの製造方法を示す工場新面図。

1 … … … ファーザースメンバー

2 ··· ··· Ti ¥ 皮裹

3 … … … 2 P レジン

4 … … … プラスチック落板

5 … … 叮 V 照射

6 … … … ガラス板

7………ニッケルスペッタ

8 … … … ニッケル度弱

以上

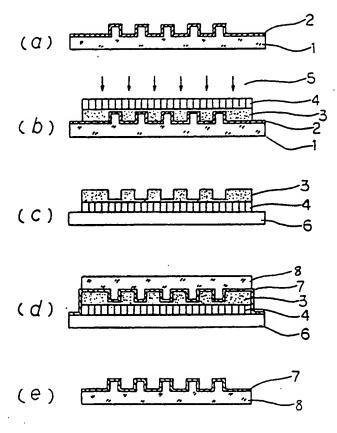
出 駅 人 セイコーエブソン株式会社 代 財 人 弁財士 鈴木び三郎(他1名) い約3004程度の厚さにする(8)。

次に、この性勢面を直接研程を行ない、所定の 厚み、面祖度に仕上げる。 最後に、このニッケル 電鍋僧(7,8)をレブリカ板より剝がし、内外 径加工・洗浄を行なって光メモリー用基板の或形 に用いるチャイルドスタンパーを製造することが 出来た。

[発明の効果]

以上、述べた様に、本発明によれば、光ディスク基板用スタンパーの製造において、リー 無数では、アー を登した。 ないで、アー などのないで、アー などのないで、アー などのないで、アー などのないで、 大ディスクを関係を行なって、 大ディスクを関ルスクンパーを製作する工程となり、 同事により、アー ないスタンパーを容易に多数枚製造する事が出来る。

また、レブリカ基板にある程度の厚さをもたせ



第1回